

部門名とキーワード

改訂:2026 年 8 月 23 日

部門名	キーワード
A:レーザー物理・化学	レーザー基礎, 量子光学, コヒーレント効果, 非線形光学, レーザー制御(パルス制御, 周波数制御等), レーザー分光, 光誘起化学, 超高速現象・相互作用, レーザー冷却, 原子光学, レーザーマニピュレーション, レーザーカオス, ドレストフォトン, ソリトン等
B:レーザー装置	固体レーザー, 気体レーザー, 液体レーザー, 自由電子レーザー, 波長変換型レーザー, 大出力半導体レーザー(固体レーザー励起用, 直接加工用), 超短パルスレーザー, 高強度(TW/PW)レーザー, ファイバレーザー, XUV/X 線レーザー, 光コム光源, レーザー共振器, 位相共役利用高輝度光源, レーザー電源, テラヘルツ発生等, ビーム整形, 波面補償, ビーム結合等
C:高強度・高エネルギーレーザー応用	高強度レーザー科学, 相対論レーザープラズマ, レーザープラズマ放射線(X 線, γ 線, 電子, イオン)・応用, レーザー核融合, レーザー粒子加速, レーザー推進, レーザー誘雷, 大出力 CW レーザーと応用, X 線レーザー応用, レーザー宇宙物理, 高次高調波発生・アト秒科学, EUV 光源等
D:レーザープロセッシング	プロセス基礎・モニタリング, 熱加工(溶接, 切断等), アブレーション, 薄膜形成, 表面改質, 微粒子(クラスター, ナノチューブ等), リソグラフィ, 3次元造形, アニール, ドーピング, 合金化, エッチング, クリーニング, 光化学プロセッシング, 超短パルスプロセッシング, マイクロファブリケーション, アディティブマニユファクチャリング等
E:レーザー計測	精密計測, 光コム計測, 生体光計測, 物性計測, 量子計測, 計測用新光源(高強度テラヘルツ発生, 中赤外発生, 波長変換等), 検出技術(テラヘルツ, X 線等), ファイバセンサー, プラズマ診断(レーザープラズマ, アブレーション等), 光による反応場計測(燃焼計測, 排気ガス検出等), 環境計測(分析, ライダー, 大気観測, リーク検出)等
F:光機能材料・デバイス	半導体レーザー, 導波路レーザー, 発光デバイス, フォトニック結晶, 非線形光学材料, 光検出器, 光導波路, 光 IC, 光電気・磁気・音響デバイス, 光材料(無機・有機), 低次元光ナノ材料, ナノフォトニクス, プラズモニクス, メタマテリアル・メタサーフェイス, 赤外・テラヘルツデバイス, 分光デバイス等
G:光通信・光無線	通信用レーザー光源, 光増幅(EDFA, ラマン等), 光信号処理(波長変換, 光スイッチ等), 光ファイバ, パルス伝搬・圧縮(線形伝搬, 非線形伝搬等), 受光デバイス, 光変調器, 光フィルタ, 光通信システム(WDM, SDM, 超高速伝送等), 量子通信, 光無線通信, 光無線給電, デジタルコヒーレント光伝送等
H:光情報処理	情報フォトニクス, デジタルオプティクス, ナノフォトニクス, AI フォトニクス, 単一画素・計算・スペクトラル・超高速・量子イメージング, 情報セキュリティ, レーザー照明, 立体・体積的・ニアアイディスプレイ, 計算機ホログラフィ, デジタルホログラフィ, 空間光変調素子, 光情報記録, 光・量子コンピューティング, VR・AR・MR・XR 光学等
I:レーザー医学・生物学	光イメージング(光トモグラフィ, 光トポグラフィ, OCT 等), 生物顕微鏡, スペクトロスコーピー, 光音響, レーザー治療(アブレーション, PDT・低出力レーザー治療等), 医科・歯科用レーザー, 医用光伝送路(中空ファイバ等), 生体光計測・診断, 医用材料, 生体光物性, バイオテクノロジー応用, 安全性等
X:複合・新規領域	投稿論文に関連する技術分野を複数(A～I), あるいは既存のキーワードがない場合は, 特徴となるキーワードを挙げてください。